

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H01L 21/68	A1	(11) 国際公開番号 WO99/28965 (43) 国際公開日 1999年6月10日(10.06.99)		
<table border="1"><tr><td data-bbox="186 466 803 1066"><p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/04372</p><p>(22) 国際出願日 1997年12月1日(01.12.97)</p><p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 大日商事株式会社(DAINICHI SHOJI K.K.)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 Tokyo, (JP) ローツェ株式会社(RORZE CORPORATION)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 Hiroshima, (JP) 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION LTD.)(JP/JP) 〒144 東京都大田区羽田旭町11-1 Tokyo, (JP)</p><p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 大山幸次(OHYAMA, Koji)(JP/JP) 中山俊哉(NAKAYAMA, Toshiya)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 大日商事株式会社内 Tokyo, (JP) 崎谷文雄(SAKIYA, Fumio)(JP/JP) 金原峰雄(KINPARA, Mineo)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 ローツェ株式会社内 Hiroshima, (JP)</p></td><td data-bbox="803 466 1419 1066"><p>藤井敏昭(FUJII, Toshiaki)(JP/JP) 堀田 修(HORITA, Osamu)(JP/JP) 〒251 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 株式会社 荏原総合研究所内 Kanagawa, (JP)</p><p>(74) 代理人 弁理士 川和高穂(KAWAWA, Takaho) 〒108 東京都港区芝五丁目14番16号 Tokyo, (JP)</p><p>(81) 指定国 JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p><p>添付公開書類 国際調査報告書</p></td></tr></table>			<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/04372</p> <p>(22) 国際出願日 1997年12月1日(01.12.97)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 大日商事株式会社(DAINICHI SHOJI K.K.)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 Tokyo, (JP) ローツェ株式会社(RORZE CORPORATION)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 Hiroshima, (JP) 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION LTD.)(JP/JP) 〒144 東京都大田区羽田旭町11-1 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 大山幸次(OHYAMA, Koji)(JP/JP) 中山俊哉(NAKAYAMA, Toshiya)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 大日商事株式会社内 Tokyo, (JP) 崎谷文雄(SAKIYA, Fumio)(JP/JP) 金原峰雄(KINPARA, Mineo)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 ローツェ株式会社内 Hiroshima, (JP)</p>	<p>藤井敏昭(FUJII, Toshiaki)(JP/JP) 堀田 修(HORITA, Osamu)(JP/JP) 〒251 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 株式会社 荏原総合研究所内 Kanagawa, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 川和高穂(KAWAWA, Takaho) 〒108 東京都港区芝五丁目14番16号 Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP97/04372</p> <p>(22) 国際出願日 1997年12月1日(01.12.97)</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 大日商事株式会社(DAINICHI SHOJI K.K.)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 Tokyo, (JP) ローツェ株式会社(RORZE CORPORATION)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 Hiroshima, (JP) 株式会社 荏原製作所(EBARA CORPORATION LTD.)(JP/JP) 〒144 東京都大田区羽田旭町11-1 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 大山幸次(OHYAMA, Koji)(JP/JP) 中山俊哉(NAKAYAMA, Toshiya)(JP/JP) 〒108 東京都港区芝浦4-15-13 大日商事株式会社内 Tokyo, (JP) 崎谷文雄(SAKIYA, Fumio)(JP/JP) 金原峰雄(KINPARA, Mineo)(JP/JP) 〒720-21 広島県深安郡神辺町宇道上1588番地の2 ローツェ株式会社内 Hiroshima, (JP)</p>	<p>藤井敏昭(FUJII, Toshiaki)(JP/JP) 堀田 修(HORITA, Osamu)(JP/JP) 〒251 神奈川県藤沢市本藤沢4-2-1 株式会社 荏原総合研究所内 Kanagawa, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 川和高穂(KAWAWA, Takaho) 〒108 東京都港区芝五丁目14番16号 Tokyo, (JP)</p> <p>(81) 指定国 JP, KR, SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>			
<p>(54)Title: CONTAINER AND LOADER FOR SUBSTRATE</p> <p>(54)発明の名称 基板のコンテナ及びローダ</p> <p>(57) Abstract</p> <p>A closed container conveys semiconductors to prevent contamination due to dust and the like. In order to fabricate semiconductors, a container is placed on a loader mounted on a side of a low-level clean room and on a border between a high level clean room and the low-level clean room. When a cover of the container is made integral with a door provided on an opening of a loader to descend in the loader, the container and the high-level clean room are opened to enable semiconductors to move between the container and the high-level clean room. Since all mechanical components, which generate dust, are placed on the side of the low-level clean room, cleanliness on a side of the high-level clean room can be kept high.</p> 				